

德国ALLRESIST 紫外光刻胶pmma-950K ar-p-672.03

产品名称	德国ALLRESIST 紫外光刻胶pmma-950K ar-p-672.03
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

特点：

用于集成电路加工、lift-off工艺、激光干涉曝光等

感光波段：i-line(365nm)、g-line(436nm)

化学放大胶，具有非常高的灵敏度

高分辨率、高对比度

可得到undercut结构，用于lift-off工艺

旋涂曲线：

应用实例：

1. [紫外光刻胶](#) (Photoresist)

各种工艺：喷涂专用胶，化学放大胶，lift-off胶，图形反转胶，高分辨率胶，LIGA用胶等。

各种波长：深紫外(Deep UV)、I线(i-line)、G线(g-line)、长波(longwave)曝光用光刻胶。

各种厚度: 光刻胶厚度可从几十纳米到上百微米。

2. [电子束光刻胶 \(电子束抗蚀剂\)](#) (E-beam resist)

电子束正胶：PMMA胶，PMMA/MA聚合物，LIGA用胶等。

电子束负胶：高分辨率电子束负胶，化学放大胶（高灵敏度电子束胶）等。

3. [特殊工艺用胶](#) (Special manufacture/experimental sample)

电子束曝光导电胶，耐酸碱保护胶，全息光刻用胶，聚酰亚胺胶（耐高温保护胶）等特殊工艺用胶。